

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第1部門第2区分

【発行日】平成27年5月21日(2015.5.21)

【公表番号】特表2014-519866(P2014-519866A)

【公表日】平成26年8月21日(2014.8.21)

【年通号数】公開・登録公報2014-044

【出願番号】特願2014-506430(P2014-506430)

【国際特許分類】

A 6 1 F 9/007 (2006.01)

【F I】

A 6 1 F 9/00 5 5 0

【手続補正書】

【提出日】平成27年4月2日(2015.4.2)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

眼の中で架橋処理を適用するためのシステムであって、

システムは、

光源からの光のビームを受け、所定の強度プロフィールにしたがって、光のビームから、眼の中の処置区域に向けられる出力光を生成し、出力光が処置区域に適用された架橋剤を活性化するように構成されたビームコンディショニングシステム、及び

ビームコンディショニングシステムのための所定の強度プロフィールを決定する情報を受けるように構成された制御装置

を含み、

所定の強度プロフィールにしたがって、出力光の異なる部分が、処置区域のための異なるそれぞれのエネルギー束を提供し、

ビームコンディショニングシステムが、出力光の異なる部分を、処置区域の異なるそれぞれの領域に向け、処置区域の中の架橋活性の所望のパターンを生成するように構成され、

相対的に大きなエネルギー束を受ける処置区域の領域が、相対的により多量の架橋活性を受ける、システム。

【請求項2】

ビームコンディショニングシステムが、所定の強度プロフィールにしたがうピクセル化出力光を生成するための、選択的に調整可能なミラーのアレイを有するデジタルマイクロミラー装置を含む、請求項1に記載のシステム。

【請求項3】

ビームコンディショニングシステムが、出力光の第一の部分を処置区域の中央領域に向け、出力光の第二の部分を処置区域の中央領域の周辺に配置される周辺領域に向け、出力光の第一の部分及び第二の部分が、それぞれ中央領域及び周辺領域に、異なるエネルギー束を提供する、請求項1に記載のシステム。

【請求項4】

出力光の部分が、処置区域の1つ以上の領域が出力光のどの部分も受けず、架橋活性の所望のパターンが不連続であるように配接される、請求項1に記載のシステム。

【請求項5】

ビームコンディショニングシステムが、出力光の一部を、処置区域の環形領域に向け、架橋活性の所望のパターンが環形領域により決定される、請求項1に記載のシステム。

【請求項6】

ビームコンディショニングシステムが、出力光の一部を、処置区域の橜円形領域に向け、架橋活性の所望のパターンが橜円形領域により決定される、請求項1に記載のシステム。

【請求項7】

ビームコンディショニングシステムが、後続の工程で、異なる強度プロフィールを持つ1つ以上のさらなる出力光を処置区域に向けるために制御可能であり、架橋活性のさらなる所望のパターンをそれぞれ生成する、請求項1に記載のシステム。

【請求項8】

制御装置により受ける情報が近視の処置の処置計画の態様を含み、情報により決定される架橋活性の所望のパターンが、近視に対処する処置区域の光学的屈折率等高線の変化を結果的に生じさせる、請求項1に記載のシステム。

【請求項9】

制御装置により受ける情報が遠視の処置の処置計画の態様を含み、情報により決定される架橋活性の所望のパターンが、遠視に対処する処置区域の光学的屈折率等高線の変化を結果的に生じさせる、請求項1に記載のシステム。

【請求項10】

制御装置により受ける情報が乱視の処置の処置計画の態様を含み、情報により決定される架橋活性の所望のパターンが、乱視に対処する処置区域の光学的屈折率等高線の変化を結果的に生じさせる、請求項1に記載のシステム。